

## О ДОЛИННОМ ВЫРОЖДЕНИИ ДВУМЕРНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ У ПОВЕРХНОСТИ (111) КРЕМНИЯ

Г.М.Гусев, Н.В.Заварицкий, З.Д.Квон,  
А.А.Юргенс

Впервые проведено прямое измерение кратности долинного вырождения двумерных электронов у поверхности (111) кремния в отсутствие магнитного поля. Обнаружено, что величина долинного вырождения равна шести в отличие от значения, равного двум, полученного из измерений осцилляций Шубникова – де Гааза.

В физике двумерных электронных систем проблема долинного вырождения двумерных электронов на поверхности (111) кремния относится к числу наиболее давних и до настоящего времени нерешенных. Эта проблема возникла почти десять лет назад после первых же измерений шубниковских осцилляций в двумерном электронном газе на поверхности (111) кремния <sup>1, 2</sup>. Величина долинного вырождения, найденная в этих экспериментах из периода осцилляций оказалась равной двум, а не шести как следовало бы ожидать из теоретических предсказаний, основанных на приближении эффективной массы <sup>3</sup>. Обнаруженный парадокс породил целый ряд моделей <sup>4</sup>, ни одна из которых не давала убедительного решения его. Спустя несколько лет было обнаружено, что после ряда специальных обработок поверхности кремния перед его окислением можно получить образцы с  $g_v = 6$  <sup>5</sup>. Этот факт внес еще большую неопределенность в описываемую проблему, которая остается и по сей день <sup>6, 7</sup>.

Трудность в решении этой проблемы заключалась не только в сугубо теоретических вопросах, но и в том, что измерения осцилляций Шубникова – де Гааза являлись единственным методом, на основе которого определялась кратность долинного вырождения. В связи с этим особый интерес представляет определение  $g_v$ , другим методом, не связанным с магнитными измерениями.

Такая возможность была обнаружена в ходе исследования фононного увлечения двумерных электронов в инверсионных слоях на поверхности (001) кремния<sup>8</sup>. Суть метода состоит в том, что в двумерной системе фонон-электронное взаимодействие имеет резкую особенность, когда волновой вектор фона  $q_{ph}$  сравнивается с удвоенным ферми-вектором  $k_F$ , т. е. когда

$$q_{ph} = 2k_F \quad (1)$$

(см.<sup>8</sup> и там же соотношение<sup>2</sup>). Если в исследуемом образце МДП структуры фиксировать поверхностную плотность зарядов  $N$ , установив напряжение на затворе  $V_g$ , то особенность при  $q_{ph} = 2k_F$  проявится как максимум на кривой зависимости ( $\alpha_{ph} \kappa^{-1}$ ) от температуры, когда  $q_{ph}$ , соответствующий максимуму теплового распределения фонанов, сравняется с величины  $2k_F$  ( $\alpha_{ph}$  – термоэдс, связанная с фононным увлечением зарядов,  $\kappa$  – теплопроводность образца). Так как величина  $k_F$  связана с поверхностной плотностью зарядов соотношением

$$N = 2g_v \pi k_F^2 (2\pi)^{-2} \quad (2)$$

(для сферической поверхности Ферми), а величина  $q_{ph}$  с температурой образца

$$q_{ph} = 4,96 \frac{k}{\hbar} \frac{T}{\bar{u}} \simeq 1,2 \cdot 10^6 \text{ Т} \cdot \text{см}^{-1}, \quad (3)$$

где  $\bar{u}$  – средняя скорость фонанов, 4,96 – коэффициент в законе смещения Вина, то, используя соотношения (1), (2), (3), можно определить  $g_v$ .

Для эксперимента использовались МДП структуры, изготовленные по стандартной технологии на поверхностях близких к (111) ( $8^\circ 30'$  к (111)). Максимальная подвижность носителей при 4,2К была равна  $3000 \text{ см}^2 (\text{В} \cdot \text{с})^{-1}$ . Измерения термоэдс проводились описанной ранее<sup>9</sup> методикой в интервале  $0,4 \div 9 \text{ К}$ .

Известно, что термоэдс зарядов обусловлена диффузией электронов  $\alpha_e$  и их увлечением фононами  $\alpha_{ph}$ . Диффузная часть пропорциональна температуре и может быть выделена экстраполируя зависимость  $\alpha/T$  от  $T^2$  к нулю температуры. Таким путем определялось значение  $\alpha_e$  для каждой исследуемой концентрации  $N$  с точностью  $\sim 10\%$ . В интервале концентраций от 1,5 до  $5,3 \cdot 10^{12} \text{ см}^{-2}$   $\alpha_e T^{-1}$  изменяется от  $10^{-5}$  до  $2,6 \cdot 10^{-6} \text{ В} \cdot \text{К}^{-2}$ . Полученные значения использовались для уточнения величины  $\alpha_{ph}$ . Правка на вклад от  $\alpha_e$  вблизи максимумов  $\alpha_{ph} \kappa^{-1}$  не превосходила 10% от  $\alpha_{ph}$ .

Зависимость  $\alpha_{ph} \kappa^{-1}$  от температуры представлена на рис. 1. На этом же рисунке представлена зависимость  $T^*$  – температуры при которой расположен максимум  $\alpha_{ph} \kappa^{-1}$  от  $N^{1/2}$ . Видно, что  $T^*$  изменяется прямо пропорционально  $N^{1/2}$ , как это можно было ожидать из приведенных выше соотношений. Однако, наклон прямой  $T^*(N^{1/2})$  существенно (в 2,4 раза) отличается от полученного ранее<sup>8</sup> для структур на (100) поверхностях, где  $g_v = 2$ . Изменение наклона прямой  $T^*(N^{1/2})$  свидетельствует, что величина  $g_v$  для исследованных образцов (111) существенно превосходит 2.

Расчет кратности долинного вырождения по фононному увлечению на поверхности (111) кремния осложнен тем, что поверхность Ферми в этом случае, в приближении эффективной массы<sup>3</sup> состоит из шести эллипсов с осями отличающимися в 1,9 раз. Соотношение (2) при этом приобретает вид

$$N = 2g_v \pi k_1 k_2 (2\pi)^{-2},$$

где  $k_1$  и  $k_2$  – полуоси ферми-эллипса. При несферической поверхности неочевидно, какому значению  $k_F$  соответствует условие (1). Поток тепла в опытах был направлен параллельно минимальному размеру двух долин, и, видимо, именно этот размер надо подставлять в соотношение (1). В этом случае получаем, что  $g_v = 6$ . Если предположить, что максимум  $(\alpha_{ph} \kappa^{-1})$  соответствует большему значению  $k_F$ , то это приведет лишь к увеличению расчетного значения  $g_v$ .

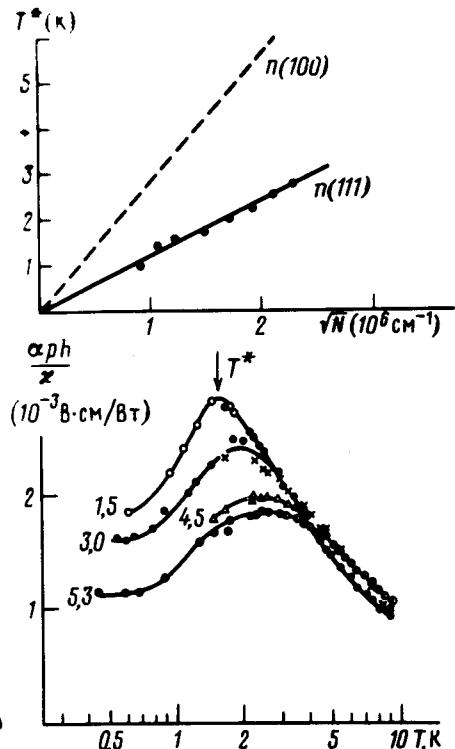


Рис. 1. Зависимость  $\alpha_{ph} \kappa^{-1}$  от  $T$ (К). Параметром кривых является плотность электронов  $N$  (в единицах  $10^{12} \text{ см}^{-2}$ ):  $\circ, \otimes, \oplus$  – относятся к измерениям в криостате с низкотемпературной ванной  $\text{He}^3$  ( $T = 0,3\text{K}$ );  $\bullet, \ominus, \times, \blacktriangle$  – относятся к измерениям в обычном криостате  $\text{He}^4$ . Стрелкой указан температура  $T^*$ . На верхнем графике показана зависимость  $T^*$  от  $N^{1/2}$ . Пунктирная линия показывает ту же зависимость для структур  $n(100)$ , для которых  $g_v = 2$

У тех же образцов была измерена зависимость проводимости  $\sigma_{\square}$  от напряжения на затворе в магнитном поле 90 кГс (рис. 2). Наклон прямой 1, пропорциональный периоду наблюдаемых осцилляций соответствует  $g_v = 2 \pm 0,1$ . Для сравнения показана прямая 2, соответствующая  $g_v = 6$ .

Приведенные результаты показывают, что в отсутствие магнитного поля значение долинного вырождения электронов на поверхности (111) кремния равно шести в соответствии с предсказаниями, основанными на приближении эффективной массы, а не двум, как следует из измерений шубниковских осцилляций.

Для решения этого противоречия следует провести дополнительное рассмотрение особенностей поведения двумерных электронов в квантующих магнитных полях.

Авторы признательны Н.А.Никитину за техническую помощь.

#### Литература

1. Neugebauer T., von Klitzig, Landwehr G., Dorda G. Solid State Comm., 1975, 17, 295.
2. Lakhani A.A., Stiles P.J. Phys. Lett., 1975, A 51, 117.
3. Stern F., Howard W.E. Phys. Rev., 1967, 163, 816.

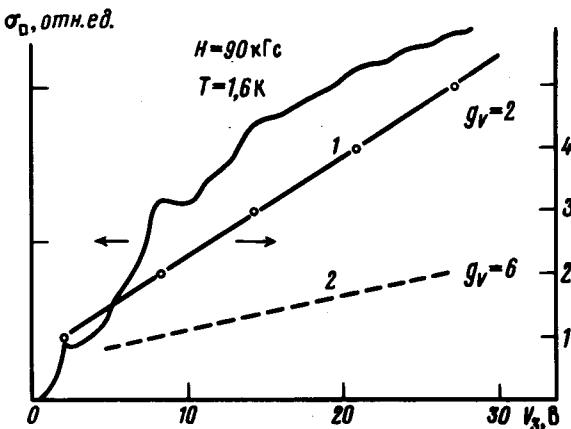


Рис. 2. Зависимость проводимости  $\sigma_{\square}$  от напряжения  $V_g$  на затворе. Справа на оси ординат отложен член  $\sigma_{\square}$  шубниковских осцилляций. Пунктирная прямая соответствует  $g_v = 6$

4. *Ando T., Fowler A.B., Stern F.* Rev. of Modern Phys., 1982, **54**, 437.
5. *Tsui D.C., Kaminsky G.* Phys. Rev. Lett., 1979, **42**, 595.
6. *T.Cole* p. 41; *K.S.Yiand, J.J.Quinn* p. 50, *A.Kastalsky* p. 153, *K.C.Woo* p. 278. "Electronic properties of two-dimensional systems". Proceedings of the fourth international conference on electronic properties of two-dimensional systems. Ed. Frank Stern, North – Holland, Amsterdam.
7. *Cole T., McCombe B.D.* Phys. Rev., 1984, **29**, 3180.
8. Заварицкий Н.В., Квон З.Д. Письма в ЖЭТФ, 1983, **38**, 85.
9. Заварицкий Н.В., Заварицкий В.Н. ЖЭТФ , 1982, **83**, 1182,

Институт физических проблем

Академии наук СССР

Институт физики полупроводников

Академии наук

Сибирское отделение

Поступила в редакцию  
6 июля 1984 г.